

化学工学会第 52 回秋季大会 材料・界面部会横断型シンポジウム(共催)  
ST-22 CVD・ドライプロセス –構造・機能制御の反応工学– 報告書

オーガナイザー

河瀬 元明 (京都大学) (文責)

三宅 雅人 (奈良先端科学技術大学院大学)

玉置 直樹 (キオクシア(株))

齊藤 丈靖 (大阪府立大学)

2021 年 9 月 22～24 日にオンライン開催された化学工学会第 52 回秋季大会にて本シンポジウムが開催され、合計 24 件の講演発表が行われた。詳細は下記の通りである。

日時	9 月 25 日 9:20～15:20 13 件(展望講演 1 件、招待講演 1 件を含む) 9 月 26 日 9:00～14:20 11 件(展望講演 1 件、招待講演 1 件を含む)
会場	オンライン
聴講者数	27 名
展望講演	VC106 『半導体メモリの技術・経済・産業の現在と発展する未来』(マイクロンメモリジャパン) 青砥 なほみ VC201 『反応性プラズマを用いたナノ粒子の成長制御とその応用展開』(九大シス情) 古閑 一憲
招待講演	VC119 『長尺・高密カーボンナノチューブ(CNT)・アレイから作製する CNT 乾式紡績糸の物性制御とエネルギー・メカニカルデバイスへの応用』(岡山大院自然) 林 靖彦 VC206 『プラズマ照射下の空間マイクロかつ時間マクロな構造変化の再現計算への挑戦』(核融合研) 伊藤 篤史

以上